

名城大学 LED 共同研究センター

装置・料金一覧

令和4年6月1日付

	設備名称		設備利用料 (円/1時間)	最低 使用 時間	ガス・薬品 代表例 (円/1時間)	原料・消耗品部材 代表例 ※基板は含んでいません
1	MOCVD装置 (大陽日酸EMC)		9,364		水素 (2,146)、アンモニア (3 (円/g))	Cp ₂ Mg (1,584 (円/0.1g))
2	MOCVD装置 (AIXTRON)		10,866		水素 (715)、アンモニア (3 (円/g))	
3	スパッタリング装置	※	4,508		高純度酸素ガス (65)	Ni (55 (円/Wh))
4	マスクアライナー装置	※	809		AZ ディベロッパ (1,030)	
5	高真空蒸着装置	※	3,930	1H	高純度酸素ガス (65)	金 (9,260 (円/g))
6	熱処理装置		5,086		ヘリウムガス (70)	
7	赤外線ランプアニール装置	※	3,930		高純度酸素ガス (65)	
8	ラッピング装置		2,081			スリ-6μm (2,880 (円/h))
9	研削装置		1,503			砥石 #1000 (1,620 (円/h))
10	レーザスクライブ装置		9,826	2H		一般感圧テープ (620 (円/h))
11	ウェハPLマッピング装置		1,503	2H		
12	微分干渉顕微鏡		116			
13	X線回折装置		1,965	2H		
14	表面形状測定器	※	1,156	1H		
15	コンフォーカル顕微鏡	※	1,965	1H		
16	全固体連続発振UVレーザ		2,543	1H		
17	カート・ルネッサンス観察分析システム SEM		1,965	1H		
	CL		2,774	1H		
18	SiCライフタイム測定装置	※	2,312			
19	ナノインプリント装置	※	5,318		オプツール (70)	ガラスシート (2,430 (円/枚))
20	膜厚モニター	※	1,503	1H		
21	積分球		1,040	1H		
22	LEDテスター		231	1H		
23	スピンコーター	※	462			
24	エッチング装置	※			ヘリウムガス (70)	

—	クリーンルーム使用料		2,086			
---	------------	--	-------	--	--	--

※クリーンルーム維持に費やす電気代・水道代・薬品代はクリーンルーム入室時間に応じて別途徴収します。

- ・設備利用料の内訳は、光熱費、室素、共通の消耗品・一部の薬品、メンテナンス料、出向者の人件費の概算金額です。
- ・設備利用料単価は、毎年度見直しを行います。(12月までの実績により翌年度分を決定)
- ・ガス・消耗品部材・原料などは代表的なものであり、追加、同等類への変更があります。また実費徴収によるため、今後の購入価格等により年度内においても変動する場合があります。
- ・基板は原則持ち込みください。
- ・最低使用時間のある装置は、実稼働時間ではなく上記最低使用時間で設備利用料を徴収します。
実費徴収のガス・消耗品部材・原料などは実稼働時間(分単位)で徴収します。